

高真空環境用 ホットプレート PH220D-2010型



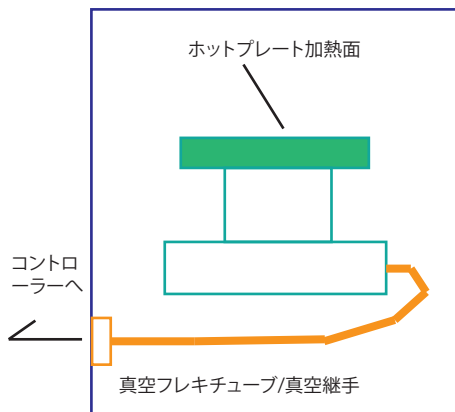
特徴



- 最高温度 200℃ 対応
高真空環境用ホットプレート
真空環境 10-5Pa対応
- 発熱部、センサー配線等を溶接気密構造ケースに配置し、高真空下での使用に対応
- 低価格、短納期での提供が可能です。
- カスタム対応ですので、サイズ、取付金具、チャンバーへのフランジおよび継手タイプなどで指定にて製作いたします。

構造 アプリケーション

アプリケーション:ウエハ加熱、ガラス加熱その他 加熱プロセスに対応
真空チャンバー内へ設置可能なホットプレート
ヒータ、センサ、配線などは、すべてシャーシ内へ内蔵されているため、高真空環境でもアウトガスの発生がありません。



真空チャンバー



OEM部品対応

- ユーザー装置に合わせた設計対応品です。
- 取付固定用金具、真空フランジタイプ(溶接タイプ、スエジロック等)など、ご指定のタイプで製作可能です。

高真空環境ホットプレート PH220D-2010型

仕様カスタマイズ

温度制御範囲	室温～200℃	○:カスタマイズ対応
プレートサイズ	φ100mm	—
フランジ	VCR,スエジ等	○
プレート材質	アルミ合金、アルマイト処理	○
消費電力	AC100V、5A	○

詳細の仕様につきましては、仕様書を提出させていただきます。